

ИЗМЕНЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛЕНОК ВТСП ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НИЗКОТЕМПЕРатурного ИОННОГО ОБлучения

С.В. А н т о н е н к о, А.И. Г о л о в а ш к и н,
В.Ф. Е л е с и н, И.А. Е си н,
П.Б. Ж и л и н, В.Е. Ж у ч к о в,
С.И. Красносвободцев,
А.С. М о л ч а н о в, Е.В. П е ч е н ь,
Б.М. П о п о в, И.А. Р у д н е в

Сверхпроводящие пленки $YBa_2Cu_3O_7$ были облучены ионами He^{++} с энергией 3.6 МэВ при температурах 30 и 300 К. При низкотемпературном облучении обнаружено, что деградация T_c и j_c происходит медленнее, чем при $T_c^{\text{обл}} = 300$ К; при небольших флюенсах наблюдается рост T_c ; нагрев до 300 К сопровождается значительным увеличением T_c и j_c .

В настоящее время имеется много экспериментальных фактов, демонстрирующих определяющую роль кислорода и его распределения в элементарной ячейке на сверхпроводящие характеристики ВТСП. Воздействие высокогенергетичными ионами, нейtronами и электронами позволяют изменять положения атомов (в частности кислорода) в структуре ВТСП. Уже в первых работах была обнаружена необычайная чувствительность критических характеристик ВТСП к ионному [1, 2] и нейтронному [3] облучению. Эта чувствительность оказалась в 4–10 раз выше, чем в сверхпроводниках со структурой A15. Дальнейшие работы подтвердили эти результаты (см., например, [4, 5]). В упомянутых работах облучение проводилось при сравнительно высоких температурах (80–300 К). В то же время известно, что процесс образования радиационных дефектов может существенно зависеть от температуры.

Целью настоящей работы являлось сравнение влияния температурных условий облучения ($T_c^{\text{обл}} = 30$ и 300 К) на дозовые зависимости T_c , j_c . Оказалось, что температура облучения сильно влияет на скорость изменения T_c и j_c , приводя (в случае низкотемпературного облучения) к ряду необычных эффектов.

Три сверхпроводящие пленки $YBa_2Cu_3O_7$ были получены методом лазерного напыления на подложки из титаната стронция. Пленки были облучены на циклотронном ускорителе ионами гелия. Интенсивность ионного пучка составляла $-10^{12}-3 \times 10^{12} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$. Основные характеристики образцов и температуры облучения приведены в таблице.

Режим облучения образцов 1 и 2 состоял в следующем. Образец 1 весь цикл облучался при $T_c^{\text{обл}} = 30$ К. После набора флюенса непосредственно в камере ускорителя измерялись T_c , $A T_c$, j_c . При измерениях образец не нагревался выше 100 К. Образец 2 между циклами низкотемпературного облучения выдерживался 10–

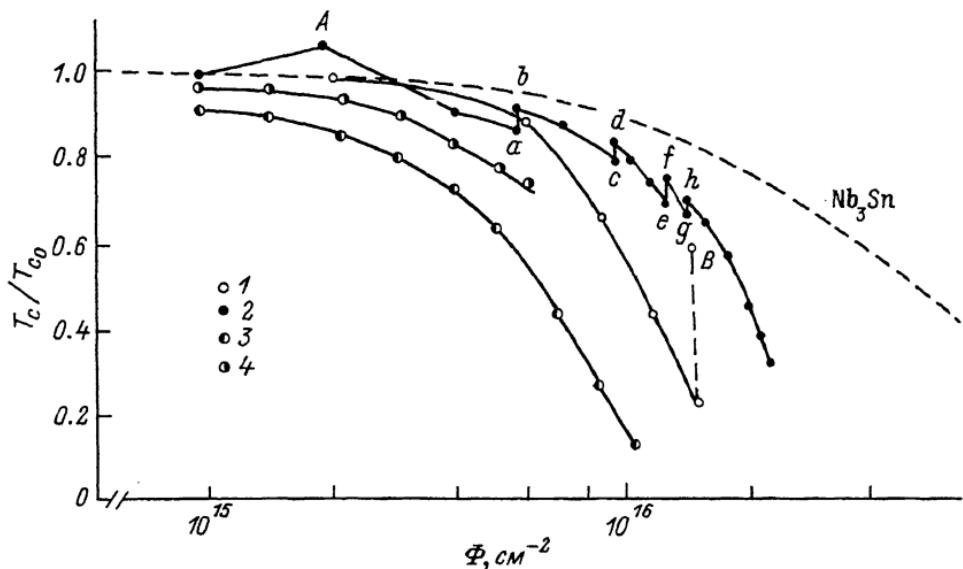


Рис. 1. Зависимость приведенной критической температуры от флюенса (1 - образец 1; 2 - образец 2; 3, 4 - образец 3 (3 - индукт. метод).

№ обр.	$T_{\text{сн}}, \text{К}$	$T_c, \text{К}$	$T_{\text{ск}}, \text{К}$	$j_{c,77}, \text{А/см}^2$	Толщина, мкм	Темпера- тура облуче- ния, К
1	81.5	75.0	69.8	-	0.110	30
2	89.7	88.8	88.0	6.7×10^5	0.075	30
3	91.0	88.0	86.0	-	0.200	300

П р и м е ч а н и е. $T_{\text{сн}}$, T_c , $T_{\text{ск}}$ - температуры, соответствующие уровням 0.9; 0.5; 0.1 изменения электросопротивления при переходе в сверхпроводящее состояние; $j_{c,77}$ - плотность критического тока при $T = 77 \text{ К}$.

1.2 часов в вакууме при температуре 300 К; для этого образца исследовалась температурная зависимость электросопротивления (в диапазоне температур 20–300 К) после различных доз облучения.

Экспериментальные результаты приведены на рис. 1, 2. Анализ показывает, что в целом качественное поведение T_c , j_c , удельного электросопротивления ρ при низкотемпературном облучении такое же, как и при $T_{\text{обл}} = 300 \text{ К}$. Действительно, наблюдается падение T_c , j_c (j_c быстрее, чем T_c), рост dT_c/dT ($\rho(T)$ (с изменением знака $d\rho/dT$)). Однако скорость изменения T_c , j_c при

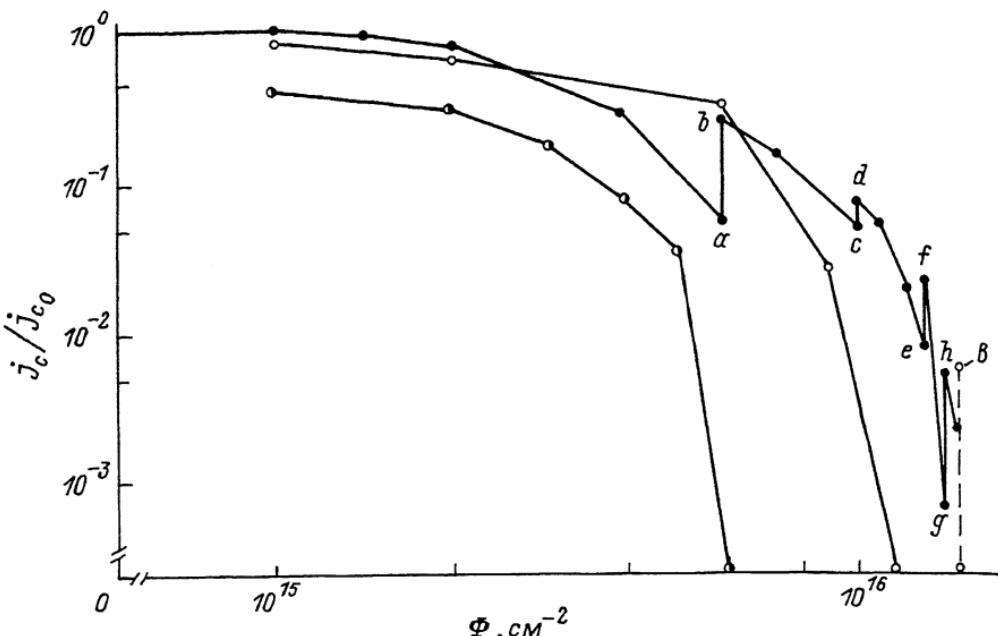


Рис. 2. Зависимость приведенного критического тока ($T_{\text{изм}} = 20 \text{ К}$) от флюенса (обозначения соответствуют рис. 1).

низкотемпературном облучении примерно в два раза меньше, чем при $T_{\text{обл}} = 300 \text{ К}$. Одновременно наблюдалось увеличение значения Φ , при котором происходила смена знака $d\rho/dT$ ($\Phi_{300} = 1.1 \times 10^{16} \text{ см}^{-2}$ против $\Phi_{300} = 4 \times 10^{15} \text{ см}^{-2}$). Такое поведение, если связать его с образованием радиационных дефектов, является необычным. Действительно, принято считать, что уменьшение температуры облучения замедляет процессы релаксации и рекомбинации дефектов и, следовательно, увеличивает вероятность дефектообразования. Вместе с тем следует отметить, что похожие явления, но менее выраженные наблюдались при низкотемпературном облучении Nb_3Sn [6].

Были отмечены также следующие особенности, присущие только низкотемпературному облучению. 1). Для образцов 1 и 2 при малых флюенсах ($\Phi = 0.5-1 \times 10^{15} \text{ см}^{-2}$) было обнаружено повышение T_c примерно на 1.5 К (точка А на рис. 1), которое сопровождалось уменьшением ΔT_c ; j_c при этом практически не изменилось. 2). Выдержка образца 2 после низкотемпературного облучения в вакууме при 300 К в течение 10-12 часов приводила к частичному восстановлению сверхпроводящих свойств, т.е. к увеличению T_c и j_c (см. точки a, b, c, d, e, f, g, h на рис. 1, 2) и одновременному уменьшению ΔT_c и ρ . 3). Выдержка облученных образцов на воздухе в течение двух недель при $T = 300 \text{ К}$ привела к восстановлению T_c и j_c для образца 2 (точки В на рис. 1, 2). Значение T_c составило 49 К. Восстановление T_c сопровождалось уменьшением ΔT_c , ρ . Восстановленные значения

T_c , ΔT_c , ρ практически полностью совпали с соответствующими значениями, которые имела пленка при $\Phi = 10^{16} \text{ см}^{-2}$.

Анализ радиационного воздействия на ВТСП показывает, что имеется определенная аналогия с характером воздействия на сверхпроводники типа А15. Действительно, наблюдается падение T_c , ρ с особенностями, присущими низкотемпературному облучению, рост ρ , смена знака $d\rho/dT$ при определенных флюенсах, увеличение периода решетки и др. Имеются и отличия. Например, больший масштаб всех наблюдаемых явлений, падение T_c практически до нуля (в сверхпроводниках А15 выход на насыщение), неограниченный рост ρ . Оценки показывают, что экспериментальные данные можно интерпретировать, воспользовавшись моделью с пиком в плотности электронных состояний [7]. Однако используемый в модели [7] эффект размывания пика из-за рассеяния на дефектах следует дополнить учетом изменения положения уровня Ферми за счет перераспределения вакансий кислорода в элементарной ячейке. Последний эффект приводит к уменьшению концентрации дырок, и, следовательно, к полупроводниковому типу проводимости и обращению T_c в нуль.

Л и т е р а т у р а

- [1] А н т о н е н к о С.В., Е в с т и г н е е в В.В., Е л е - си н В.Ф. и др. Проблемы высокотемпературной сверхпроводимости. Ч. П. Свердловск: УрО АН СССР, июль 1987, с. 207-208.
- [2] А н т о н е н к о С.В., Г о л о в а ш к и н А.И., Е л е - си н В.Ф. и др. - Письма в ЖЭТФ, 1988, т. 47, с. 260-263.
- [3] Д а в ы д о в С.В., К а р ь к и н А.Е., М и р м е л ъ - ш т е й н А.В. и др. - ФММ, 1987, т. 64, в. 2, с. 399-400.
- [4] G e e r k J., L i n k e r G., M e u e r O. at all. - Z. Phys. B, 1987, v. 67, p. 507-511.
- [5] C o s t J.R., W i l l i s J.O., T h o m p - s o n J.D. at all. - Phys. Rev. B, 1987, v. 37, p. 1563-1568.
- [6] Д е г т я р е н к о Н.Н., Д е ж у р к о К.И., Е л е - си н В.Ф. и др. - Препринт МИФИ 009-85, 1985, 24 с.
- [7] А л е к с а н д р о в А.С., Е л е си н В.Ф., К а з е - ко М.П. - ФТГ, 1979, т. 21, с. 2062.

Московский инженерно-физический
институт

Поступило в Редакцию
18 августа 1988 г.